# Rec'd P&T/PTO 11 JUL 2005

# 1n/5 965

PCT/JP 2004/000084

#### 本 JAPAN PATENT OFFICE

08. 1. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 1月10日 REC'D 2 7 FEB 2004

WIPO

願 番 Application Number:

特願2003-004282

[ST. 10/C]:

[JP2003-004282]

Applicant(s):

三星ダイヤモンド工業株式会社

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner. Japan Patent Office 2004年 2月13日





**BEST AVAILABLE COPY** 



【書類名】

特許願

【整理番号】

39685

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

C03B 33/00

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府吹田市南金田2丁目12番12号 三星ダイヤモ

ンド工業株式会社内

【氏名】

藤井 昌宏

【特許出願人】

【識別番号】

390000608

【氏名又は名称】 三星ダイヤモンド工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100084364

【弁理士】

【氏名又は名称】 岡本 宜喜

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 044336

【納付金額】

21,000円

【提出物件の日録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】 【物件名】 図面 1 要約書 1

【包括委任状番号】 0203419

【プルーフの要否】

要



# 【書類名】 明細書

【発明の名称】 脆性材料基板のスクライブ装置及びスクライブ方法並びに自動 分断ライン

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 脆性材料基板の表面におけるスクライブ予定ラインに沿って、該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の近傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライブ予定ラインに沿ってプラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライブ装置であって、

前記脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したプラインドクラックの形 成領域に向けて配置されたセンサ用の光ファイバと、

前記光ファイバに光を入射する投光部と、

前記光ファイバから投光されブラインドクラックによって反射された光を前記 光ファイバを介して受光する受光部と、

前記受光部より得られた受光レベルを判別する判別部と、を具備することを特 徴とする脆性材料基板のスクライブ装置。

【請求項2】 脆性材料基板の表面におけるスクライブ予定ラインに沿って、該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の近傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライブ予定ラインに沿ってプラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライブ装置であって、

前記脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したプラインドクラックの形 成領域に向けて配置されたセンサ用の第1,第2の光ファイバと、

前記第1の光ファイバに光を入射する投光部と、

前記光ファイバから投光されプラインドクラックを透過した光を前記第2の光 ファイバを介して受光する受光部と、

前記受光部より得られた受光レベルを判別する判別部と、を具備することを特 徴とする脆性材料基板のスクライブ装置。

【請求項3】 前記判別部は、所定の反射光量レベルの上下に閾値を設け、 その閾値を逸脱する範囲をプラインドクラックの形成状態の良否を判別すること



を特徴とする請求項1又は2記載の脆性材料基板のスクライブ装置。

【請求項4】 脆性材料基板の表面におけるスクライブ予定ラインに沿って、該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の近傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライブ予定ラインに沿ってブラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライブ方法であって、

前記脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したブラインドクラックの形 成領域に向けて光ファイバを介して光を入射1...

ブラインドクラックから得られる反射光を前記光ファイバを介して受光し、

その受光レベルに基づいてブラインドクラックの形成状態を確認しつつスクライブすることを特徴とする脆性材料基板のスクライブ方法。

【請求項5】 脆性材料基板の表面におけるスクライブ予定ラインに沿って、該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の近傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライブ予定ラインに沿ってプラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライブ方法であって、

前記脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したプラインドクラックの形 成領域に向けて第1の光ファイバを介して光を入射し、

プラインドクラックを透過した光を第2の光ファイバを介して受光し、

その受光レベルに基づいてプラインドクラックの形成状態を確認しつつスクライブすることを特徴とする脆性材料基板のスクライブ方法。

【請求項 6 】 請求項 1 又は 2 に記載の少なくとも 1 台の脆性材料基板のスクライブ装置と、少なくとも 1 台のブレイク装置を備えたことを特徴とする脆性材料基板の自動分断ライン。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、フラットパネルディスプレイ (以下、FPDという) に使用されるガラス基板、半導体ウェハ等の脆性材料基板を切断する際に使用されるスクライブ装置とスクライブ方法、及びこれを用いた自動分断ラインに関するものである



[0002]

### 【従来の技術】

一対のガラス基板を貼り合わせたFPDは、夫々が大寸法のマザーガラス同士を相互に貼り合わせた後に、所定の大きさになるように分断されて製造される。 貼り合わされたマザーガラスを分断する際には、夫々のマザーガラスにあらかじめカッターによってスクライブラインが形成される。

### [0003]

近年、特許文献1にも示されているように、スクライブラインを形成するためにレーザピームを使用する方法が実用化されている。レーザピームを使用してガラス基板にスクライブラインを形成する方法では、図11に示すように、ガラス基板111に対してレーザ発振装置112からレーザピームが照射される。レーザ発振装置112から照射されるレーザピームは、スクライブ予定ラインに沿って楕円形状のレーザスポットLSをガラス基板111上に形成する。ガラス基板111とレーザ発振装置112から照射されるレーザピームは、レーザスポットの長手方向に沿って相対的に移動させられる。

# [0004]

又ガラス基板111の表面におけるレーザビームの照射領域の近傍には、スクライブラインが形成されるように、冷却ノズル113から冷却水等の冷却媒体が吹き付けられるようになっている。レーザビームが照射されるガラス基板111の表面には、レーザビームによる加熱によって圧縮応力が生じた後に、冷却媒体が吹き付けされることにより引っ張り応力が生じる。このように圧縮応力が生じた領域に近接した領域に引っ張り応力が生じるために。両領域間に夫々の応力に応じた応力勾配が発生し、ガラス基板111には、ガラス基板111の端部に形成された切り目からスクライブ予定ラインに沿って垂直クラックが形成されていく。

### [0005]

このようにしてレーザビームでガラス基板111の表面に形成される垂直クラックは微小なため、通常、肉眼では目視することができないので、プラインドクラックBCといわれている。



[0006]

スクライプラインとしてのプラインドクラックBCをガラス基板111に形成すると、ガラス基板111を次の分断工程に移動させて、プラインドクラックBCの幅方向に曲げモーメントが作用するようにガラス基板に力を加える。これにより、ガラス基板111はスクライブラインであるプラインドクラックBCに沿って分断される。

[0007]

【特許文献1】

特許第3027768号

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

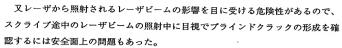
このようなスクライブ装置では、レーザビームによる単位面積当りの照射エネルギーによる加熱、冷却媒体による冷却、レーザビームとガラス基板との相対的な移動速度等の条件設定が適切でない場合には、プラインドクラックBCが正常に形成されない場合がある。ガラス基板にプラインドクラックBCが正常に形成されずにガラス基板が次の分断工程に供給されると、ガラス基板はプラインドクラックBCに沿って分断されず、ガラス基板が破損してしまう。このように、分断工程においてガラス基板が破損すると、FPDの部品として使用することができず、経済性が損なわれると共に、FPDの生産効率も低下することになる。又ガラス基板の破損によって、ガラス基板を分断するための装置自体が破損する恐れもある。

[0009]

このために、スクライブ装置において、ガラス基板にプラインドクラックBCが確実に形成されていることを確認することが望ましい。しかしながら、ガラス基板内に形成されるプラインドクラックBCはそれによる形状変化が微小であって、通常、目視すること及びCCDカメラにより直接的に観察することができない。そのためスクライブ装置において、ブラインドクラックBCが正常に形成されていることを確認することは容易でないという問題があった。

[0010]





### [0011]

本発明はこのような問題を解決するものであり、ガラス基板等の脆性材料基板の表面に形成されるプラインドクラックの形成状況を確実に確認して、脆性材料基板の分断工程において脆性材料基板を確実に分断することができる脆性材料基板のスクライブ装置とスクライブ方法、及びこれを用いた自動分断ラインを提供することを目的とする。

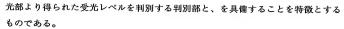
# [0012]

## 【課題を解決するための手段】

本願の請求項1の発明は、脆性材料基板の表面におけるスクライブ予定ラインに沿って、該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の近傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライブ予定ラインに沿ってブラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライブ装置であって、前記脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したブラインドクラックの形成領域に向けて配置されたセンサ用の光ファイバと、前記光ファイバに光を入射する投光部と、前記光ファイバから投光されブラインドクラックによって反射された光を前記光ファイバを介して受光する受光部と、前記受光部より得られた受光レベルを判別する判別部と、を具備することを特徴とするものである。

# [0013]

本願の請求項2の発明は、脆性材料基板の表面におけるスクライブ予定ラインに沿って、該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の近傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライブ予定ラインに沿ってブラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライブ装置であって、前記脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したプラインドクラックの形成領域に向けて配置されたセンサ用の第1,第2の光ファイバと、前記第1の光ファイバに光を入射する投光部と、前記光ファイバから投光されプラインドクラックを透過した光を前記第2の光ファイバを介して受光する受光部と、前記受



## [0014]

本願の請求項3の発明は、請求項1又は2の脆性材料基板のスクライブ装置に おいて、前記判別部は、所定の反射光量レベルの上下に閾値を設け、その閾値を 逸脱する範囲をブラインドクラックの形成状態の良否を判別することを特徴とす るものである。

## [0015]

本願の請求項4脆性材料基板の表面におけるスクライブ予定ラインに沿って、 該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の 近傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライブ予定ラインに沿って ブラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライブ方法であって、前記脆 性材料基板の表面における冷却領域に近接したブラインドクラックの形成領域に 向けて光ファイバを介して光を入射し、プラインドクラックから得られる反射光 を前記光ファイバを介して受光し、その受光レベルに基づいてプラインドクラッ クの形成状態を確認しつつスクライブすることを特徴とするものである。

## [0016]

本願の請求項5の発明は、脆性材料基板の表面におけるスクライブ予定ラインに沿って、該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の近傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライブ予定ラインに沿ってブラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライブ方法であって、前記脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したブラインドクラックの形成領域に向けて第1の光ファイバを介して光を入射し、ブラインドクラックを透過した光を第2の光ファイバを介して受光し、その受光レベルに基づいてプラインドクラックの形成状態を確認しつつスクライブすることを特徴とするものである。

# [0017]

本願の請求項6の発明は、請求項1又は2に記載の少なくとも1台の脆性材料 基板のスクライブ装置と、少なくとも1台のブレイク装置を備えたことを特徴と



するものである。

### [0018]

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態による脆性材料基板のスクライブ装置を図面に基づいて説明する。このスクライブ装置は、例えばFPDに使用されるガラス基板を分断するための加工工程の一つとして使用される。図1は本発明の実施の形態を示す概略構成図である。このスクライブ装置は、水平な架台11上に所定の水平方向(Y方向)に沿って往復運動するスライドテーブル12を有している。

### [0019]

スライドテーブル12は、架台11の上面に沿って平行に配置された一対のガイドレール14及び15に、水平な状態で各ガイドレール14及び15に沿ってスライド可能に支持されている。両ガイドレール14及び15の中間部には、各ガイドレール14及び15と平行にボールネジ13がモータ(図示せず)によって回転するように設けられている。ボールネジ13はモータ(図示せず)によって正転及び逆転可能になっており、このボールネジ13にボールナット16が螺合する状態で取付けられている。ボールナット16は、スライドテーブル12に回転しない状態で一体的に取付けられており、ボールネジ13の正転及び逆転によってボールネジ13に沿って両方向にスライドする。これにより、ボールナット16と一体的に取付けられたスライドテーブル12が各ガイドレール14及び15に沿ってY方向にスライドする。

# [0020]

スライドテーブル12上には、台座19が水平な状態で配置されている。台座19は、スライドテーブル12上に平行に配置された一対のガイドレール21にスライド可能に支持されている。各ガイドレール21は、スライドテーブル12のスライド方向であるY方向と直交するX方向に沿って配置されている。又、各ガイドレール21間の中央部には、各ガイドレール21と平行にボールネジ22が配置されており、ボールネジ22がモータ23によって正転及び逆転されるようになっている。

# [0021]



ボールネジ22には、ボールナット24が螺合する状態で取付けられている。ボールナット24は台座19に回転しない状態で一体的に取付けられており、ボールネジ22の正転及び逆転によって、ボールネジ22に沿って両方向に移動する。これにより、台座19が各ガイドレール21に沿ったX方向にスライドする

### [0022]

台座19上には回転機構25が設けられており、この回転機構25上に回転テーブル26が水平な状態で設けられている。回転テーブル26上には切断対象であるガラス基板50が載置される。回転機構25は回転テーブル26を垂直方向に沿った中心軸の周りに回転させるようになっており、基準位置に対して任意の回転角度になるように、回転テーブル26を回転させることができる。回転テーブル26上には、ガラス基板50が、例えば吸引チャックによって固定される。

#### [0023]

回転テーブル26の上方には、回転テーブル26とは適当な間隔をあけて支持台31が配置されている。支持台31は垂直状態で配置された光学ホルダ33の下端部に水平な状態で支持されている。光学ホルダ33の上端部は、架台11上に設けられた取付台32の下面に取付けられている。取付台32上にはレーザビームを発振するレーザ発振器34が設けられており、レーザ発振器34から発振されるレーザビームが光学ホルダ33内に保持された光学系に照射される。

# [0024]

光学ホルダ33内に照射されるレーザビームは、光学ホルダ33の下端面から 回転テーブル26上に載置されたガラス基板50に照射される。ガラス基板50 には光学ホルダ33内に保持された光学系によって、所定方向に沿って長く延び る楕円形状のレーザスポットとして照射される。

# [0025]

支持台31の下方には、ガラス基板50の表面に切れ目を形成するカッターホイールチップ35が設けられている。このカッターホイールチップ35は、ガラス基板50の端部に照射されるレーザビームの長手方向に沿ってブラインドクラックのきっかけとなる切れ目を形成するために用いられ、チップホルダ36によ



って昇降可能に保持されている。

[0026]

又支持台31には、光学ホルダ33に近接して、取付位置可変に冷却ノズル37が設けられている。この冷却ノズル37からは、冷却水、He ガス、 $N_2$  ガス、 $CO_2$  ガス等の冷却媒体がガラス基板50に噴射されるようになっている。冷却ノズル37から噴射される冷却媒体は、光学ホルダ33からガラス基板50に照射されるレーザスポットの長手方向の端部に近接した位置に吹き付けられる。

[0027]

又スクライブ装置には、ガラス基板50にあらかじめパターニングされたアライメントマークを撮像する一対のCCDカメラ38及び39が設けられており、各CCDカメラ38及び39にて撮像された画像を表示するモニタ28及び29が取付台32上に夫々設けられている。

[0028]

支持台31には冷却ノズル37に近接して検出ユニット40が設けられる。検出ユニット40は冷却ノズル37からガラス基板に吹き付けられる冷却媒体の近接した領域においてプラインドクラックが正常に形成されているか否かを検出するものである。例えば検出ユニット40には、光電センサを使用し、光ファイバ41及び投受光部42、判別部43を含んで構成される。

[0029]

このようなスクライブ装置によってガラス基板50をスクライブする場合には、まず所定の大きさに分断されるガラス基板50をスクライブ装置の回転テーブル26上に載置し吸引手段によって固定する。そしてCCDカメラ38及び39によって、ガラス基板50に設けられたアライメントマークを撮像する。撮像されたアライメントマークは、モニタ28及び29によって表示され、テーブル位置決め用の画像処理装置(図示せず)でアライメントマークの位置情報が処理される。その後、支持台31に対して、ガラス基板50を載置した回転テーブル26を所定の位置に位置決めし、ガラス基板50にレーザビームによりスクライブを実施する。ガラス基板50をスクライブする際には、光学ホルダ33からガラス基板50の表面に照射する楕円形状のレーザスポットの長手方向が、ガラス基



板50に形成されるスクライブラインに沿ったX方向となる。回転テーブル26の位置決めは、スライドテーブル12上の台座19のスライド、及び回転機構25による回転テーブル26の回転によって行われる。

### [0030]

図2はスクライブ装置によってスクライブされるガラス基板50上のレーザビーム照射状態を示す模式的斜視図で、図3はそのガラス基板50上の物理変化状態を模式的に示す平面図である。

## [0031]

回転テーブル26が支持台31に対して位置決めされると、回転テーブル26がX軸方向に沿ってスライドされて、ガラス基板50の端部が、カッターホイールチップ35に対向される。そしてカッターホイールチップ35が下降して、ガラス基板50の端部に切れ目TRが形成される。

### [0032]

その後、回転テーブル26をスクライブ予定ラインに沿ってX方向にスライド しつつ、レーザ発振器34からレーザビームを照射する。そして同時に冷却ノズル37から冷却媒体、例えば冷却水を圧縮エアーと共に噴射する。

# [0033]

レーザ発振器 3 4 から発振されたレーザビームは、ガラス基板 5 0 の表面に、 楕円形状のレーザスポット L S を形成する。レーザスポット L S は、例えば長径 b が 3 0 . 0 mm、短径 a が 1 . 0 mmの楕円形状になっており、長軸が形成す べきスクライプライン方向に一致するように照射される。この場合、レーザスポット L S による加熱温度は、ガラス基板 5 0 が溶融される温度より低い、即ちガラス基板の軟化点よりも低い温度とされる。これにより、レーザスポット L S が 照射されたガラス基板 5 0 の表面は、溶融されることなく加熱される。

# [0034]

冷却ノズル37からは、レーザスポットLSが照射される領域に対して、レーザスポットLSの長軸方向に例えば2.5mmの間隔をあけたスクライプ予定ライン上である冷却ポイントCPに、冷却水が吹き付けられる。これにより、ガラス基板50の表面の冷却ポイントCPが冷却される。その結果、レーザスポット



LSと冷却ポイントCPとの間の領域に温度勾配が生じる。

### [0035]

レーザスポットLSによって加熱されたガラス基板50の表面の領域には、圧縮応力が発生し、又冷却水が吹き付けられた冷却ポイントCPには、引っ張り応力が発生する。このようにレーザスポットLSによる加熱領域に圧縮応力が発生し、冷却水による冷却ポイントCPに引っ張り応力が発生すると、レーザスポットLSと冷却ポイントCPとの間の熱拡散領域HDに発生している圧縮応力により、冷却ポイントCPに対してレーザスポットLSとは反対側の領域に大きな引っ張り応力が生じる。そしてこの引っ張り応力を利用して、ガラス基板50端部にカッターホイールチップ35により形成された切れ目TRからブラインドクラックBCが、スクライブ予定ラインに沿って発生する。前述したように、ブラインドクラックが生じた直後には目視が可能であるが、数秒後には観察不能となる。

#### [0036]

ブラインドクラックBCの深さ(深度) るは、レーザスポットLSの大きさ、 熱拡散領域HDの大きさ、レーザスポットLS及び冷却ポイントCPとガラス基 板50との移動速度Vに依存しており、次の(1)式で表される。但し、前述し たように、aはレーザスポットLSの短径、bはレーザスポットLSの長径、L は熱拡散領域HDのスクライブラインに沿った長さ(レーザスポットLSと冷却 ポイントCPとの間隔)であり、kはスクライブの対象である材料(ガラス基板 )の熱物性、加熱ビーム照射密度等に依存した係数である。

$$V = k \cdot a \quad (b+L) / \delta \quad \cdot \cdot \cdot \quad (1)$$

## [0037]

前述したように、一例としてレーザスポットLSの短径aが1.0mm、レーザスポットLSの長径bが30.0mm、熱拡散領域HDのスクライブラインに沿った長さLが2.5mmであって、ガラス基板50の移動速度が300mm/sec、レーザビームのパワーが80Wの場合には、プラインドクラックBCの深度は120μmになる。これらの数値は、各種加工条件により最適な数値の組み合わせとなるように選択されて加工に用いられる。



## [0038]

さて図2に示すように、レーザスポットLSの直後に冷却ポイントCPがあり、その直後に前述したように垂直クラックが生じる。この垂直クラックはすぐにブラインドクラックBCとなるために、検出可能な冷却ポイントCPの直後の検出ポイントDPに向けて光電センサの投受光部42より投光する。そして投光された光は図3、図5に示すように、ガラス基板50の下面で一旦反射し、その反射光がプラインドクラックに照射され、ブラインドクラックで光が乱反射され、乱反射した反射光の一部が光電センサの投受光部42に得られる。光電センサの判別部のフォトダイオードがこの反射光の光量レベルを電気信号に変換し増幅する。そして所定の閾値で弁別することによってスクライブラインの状態を検出する。

### [0039]

図5 (a) は光ファイバ41に得られるセンサ帰還光量の変化を示す図である。正常なスクライブが形成された場合は、ガラス基板のスクライブを開始した切り入り部分及び切り抜け部分のガラス基板端部では、センサ光量が図示のように増大するが、その間ではセンサ光量はほぼ一定であり、スクライブが正常に形成されていることが確認される。又図6 (a) に示すように、スクライブ予定ラインに沿ってレーザスポットLSによって加熱が開始されるマザーガラスの側辺部においてレーザスポットLSの端部によって急激に加熱されると、マザーガラスにはレーザスポットLSの前方に制御不能なクラックCRが形成されることがある。このような制御不能なクラックCRは先走りクラックといい、このクラックが生じた場合には、図5 (b) に示すように、その先走り部分で光量レベルが高くなる。又図5 (c) に示すように、スクライブラインが形成できなかった場合には反射光が得られないため、センサで検出する光量レベルが零レベルとなる。従ってガラス基板に形成されたプラインドクラックの不良状態を検出することができる。

# [0040]

又図6(b)に示すように、スクライブの予定ラインに沿ってブラインドクラックBCを形成し、レーザスポットLSによって加熱が終了するガラス基板の側



辺部においても、レーザスポットLSの端部によって急激に加熱されると、マザーガラス基板50にはその側縁からレーザスポットLSの移動方向とは反対方向に向かって制御不能なクラックCRが形成されることがある。このようなクラックCRも制御不能であり、このクラックCRが生じても反射光のレベルが高くなる。従って正常な反射光レベルの上下に所定の閾値レベルVrefl、Vref2を設定しておく。反射光のレベルがガラス基板50の端部以外でこの閾値Vref1を超え、又はこの閾値Vref2以下となれば、光電センサの判別部43より不良状態と識別する。検出ユニット40の一例である光電センサの判別部43からOK信号が出力された場合には、ガラス基板50に対するスクライブの形成作業を継続する制御がされる。これに対して検出ユニット40の判別部43からNG信号が出力された場合には、ガラス基板50に対するスクライブの形成作業を中断すると共に、後工程にガラス基板50が送られることを中断するように、作業者に異常発生を知らせる警報を発する。

### [0041]

このように、スクライブ加工中において、ガラス基板50にプラインドクラックBCが良好に形成されない場合には、スクライブ加工が中断されると共に、警報が発せられる。従ってオペレータは、スクライブの形成加工中のガラス基板50にプラインドクラックBCが正常に形成されていないことを認識することができる。これによりオペレータは、スクライブ装置の回転テーブル26上のガラス基板50を不良品として取り除く。従ってブラインドクラックBCが正常に形成されていない不良品であるガラス基板50は、次のブレイク工程に供給される恐れがない。

#### [0042]

尚図4ではプラインドクラックBCの左方から光ファイバ41、投受光部42を設けて検出するようにしているが、プラインドクラックの右方から光ファイバ41と投受光部を用いて光を投光してもよく、プラインドクラックの形成予定ラインによって使い分けるものとする。又ガラス基板50の下面に一旦光を反射させてプラインドクラックに入射させる必要はなく、直接光をプラインドクラックの形成されている位置に入射するようにしてもよい。



### [0043]

次に本発明の第2の実施の形態について説明する。第1の実施の形態では1本 の光ファイバ41を用いて投受光用としているが、投光用の光ファイバと受光用 の光ファイバを分離し、及び投光部と受光部とを分離するようにしてもよい。図 7はこの透渦型の検出ユニットの概略構成を示す図である。光ファイバ71を投 光用の第1の光ファイバとする。光ファイバ71の位置は図4の光ファイバ41 と同様とし、その先端には投光部72を設ける。又ブラインドクラックの位置を 透過した光を受光するための受光部73、受光用の第2の光ファイバ74を設け る。その他の構成は前述した実施の形態と同様である。このように投光部と受光 部とを分離すれば、投光した光のうちブラインドクラックが形成される位置を透 過した光の光量を直接検出して、ブラインドクラックが正常に形成されているか どうかを検出できる。この場合にはブラインドクラックが形成されていなければ 秀過量が多くなり、プラインドクラックが形成されている部分では透過量が減少 する。又先走り現象等の端部の図6 (a). (b) に示す異常現象の場合には、 クラック部分での乱反射のレベルが高く、透過光として得られる受光レベルが大 幅に低くなる。従って正常な透過光レベルの上下に閾値を設定しておくことによ って、プラインドクラックが形成されたときの正常な状態と異常状態とを区別し て認識することができる。

# [0044]

次に本発明の第3の実施の形態について説明する。図8に示すように、レーザビームを照射し冷却すると共に、検出ユニットを設けた支持部31をテーブルの下方に配置し、下方からブラインドクラックを形成するようにしてもよい。この場合であっても検出ユニットが小型であるため容易に対応することができる。

# [0045]

次に検出ユニット40の別の例について説明する。検出ユニット40は図9に示すように、光源としてレーザダイオード61を使用したものであってもよい。その出射光軸にレンズ62、偏光フィルタ63を介して偏光ビームスプリッタ64が配置される。偏光フィルタ63は特定の偏光方向の光のみを照射光とするためのものであり、偏光ビームスプリッタ64は偏光フィルタ63で選択された偏



光方向のレーザ光をそのまま透過させ、これと垂直方向のレーザ光を反射させるものである。偏光ビームスプリッタ64の出射端側には前述した光ファイバ41が設けられている。又光ファイバ41から得られる反射光は偏光方向がランダムであるため、その反射光の一部は偏光ビームスプリッタ64で分離される。偏光ビームスプリッタ64で分離された光はミラー65、レンズ66を介して受光素子であるフォトダイオード67に入射されるように構成されている。又フォトダイオード67に得られる信号はアンプ68により増幅され、判別部69に与えられる。判別部69はウィンドウコンバレータを含んで構成され、ウィンドウコンバレータに設定される閾値Vref3、Vref4の中間のレベルかどうかによって、プラインドクラックの形成状況の良否を判別するものである。ここでレーザダイオード61、レンズ62、偏光フィルタ63、偏光ビームスプリッタ64はセンサ用の光ファイバに光を入射する投光部を構成しており、偏光ビームスプリッタ64、ミラー65、レンズ66、フォトダイオード67は反射された光を光ファイバを介して受光する受光部を構成している。

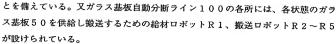
## [0046]

図10は、スクライブ装置に続けて、プレイク装置を組み込んだガラス基板50の分断自動化ラインの一例を示した単板のガラス基板の自動分断ライン100の概略模式図である。

# [0047]

このガラス基板自動分断ライン100は、ガラス基板50を収納したカセットを装着したカセットローダー101と、カセットローダー101から引き出されたガラス基板50を載置した後、載置されたガラス基板50を位置決めするコンベア102と、ガラス基板50をスクライブする本発明のスクライブ装置103と、スクライプラインが形成されたガラス基板50を載置した後、位置決めするコンベア104と、2分化したテーブルにより構成され、そのうちの少なくとも1つのテーブルを下方に回転移動させることによりガラス基板50を撓ませてガラス基板50をスクライブラインに沿って分断するプレイク装置105と、分断されたガラス基板(以下、複数枚に分断された各ガラス基板を、ガラス基板50Bという)をガラス基板自動分断ライン100外に搬出する搬出コンベア106





## [0048]

次いでこのガラス基板自動分断ライン100の動作について説明する。カセットローダー101のカセット内に収納されたガラス基板50が、給材ロボットR1により取り出され、取り出されたガラス基板50がコンベア102上に位置決めされる、その後、ガラス基板50は、搬送ロボットR2によって保持され、スクライブ装置103内に搬送される。

## [0049]

搬送されたガラス基板50は、スクライブ装置103内のテーブル上に載置される。スクライブ装置103では、上述したように、ガラス基板50に対してあらかじめ設計されたラインに沿ったブラインドクラックBCが形成される。このスクライブ装置103において、ガラス基板50の表面に、所定のブラインドクラックBCが良好に形成されなかった場合には、検出ユニット40からNG信号が出され、スクライブ装置103の動作が停止されると共に、異常発生を知らせる警報が発せられる。

# [0050]

一方スクライブ装置103において、ガラス基板50の表面上にプラインドクラックBCが良好に形成された場合には、ガラス基板50は搬送ロボットR3によって保持されて、コンベア104上に載置される。

### [0051]

コンベア104上に載置されたガラス基板50は、コンベア104の前方側において位置決めされ、搬送ロボットR4が、ガラス基板50のプラインドクラックBCが2分化したテーブル間の中央に位置するようにプレイク装置105内に搬送する。プレイク装置では、プラインドクラックが形成されるガラス基板50をプラインドクラックに沿って分断する。プレイク装置105で複数枚に分断されたガラス基板50Bは搬送ロボットR5によって搬出コンベア106上に載置される。



# [0052]

尚、別のライン構成として、検出ユニット40からNG信号が発生された場合には、所定のプラインドクラックBCが形成されなかったガラス基板50をライン100から自動搬出させる機器構成を採用することも可能である。これにより全自動運転が可能となる。

### [0053]

尚、実施の形態では、脆性材料基板としてガラス基板について説明してきたが、脆性材料基板としては単板のガラス基板だけでなく、半導体ウェハ、液晶パネルとされる貼り合わせガラス基板やセラミック基板等が含まれる。又貼り合わせ基板としてのマザー液晶パネル基板、PDP(プラズマディスプレイパネル)、LCOS、プロジェクタ基板等が含まれ、これらの種々の脆性材料基板の加工に本発明を適用することができる。

### [0054]

### 【発明の効果】

以上詳細に説明したように本発明によれば、プラインドクラックが形成されるときの目視可能な状態をセンサ用光ファイバを用いて光学的に検出しているため、検出ユニットを小型化することができ、しかもプラインドクラックが正常に形成されたかどうかを容易に識別することができる。このスクライブ装置及びスクライブ方法を自動分断ラインに適用することによってブラインドクラックが正常に形成された脆性材料基板のみを加工し、分断することができる。

# 【図面の簡単な説明】

# 【図1】

本発明の実施の形態による脆性材料基板のスクライブ装置の概略構成図である

#### 【図2】

本実施の形態によるスクライブ装置によるスクライブライン形成中のガラス基板上のレーザビーム照射位置を模式的に示す斜視図である。

#### 【図3】

ガラス基板上の物理的変化状態を模式的に示す平面図である。



#### 【図4】

本実施の形態の光ファイバセンサからガラス基板に投光された光の反射状態を 示す側面図である。

#### 【図5】

本実施の形態によるスクライブ装置の検出ユニットのガラス基板の位置に対する受光光量の変化を示すグラフである。

#### [図6]

スクライブライン形成加工中に発生する制御不能なクラックの例を示す図である。

# 【図7】

本発明の第2の実施の形態によるスクライブ装置の検出ユニットの検出状態を 示す概略図である。

#### 【図8】

本発明の第3の実施の形態によるスクライブ装置の概略構成図である。

### 【図9】

本発明の実施の形態によるスクライブ装置の検出ユニットの他の例の構成を示す図である。

#### 【図10】

スクライブ装置に続けてプレイク装置を組み込んだガラス基板の分断ラインの 一例を示すガラス基板自動分断ラインの概略図である。

#### 【図11】

レーザビームによるスクライプラインの形成方法を説明するための模式図である。

#### 【符号の説明】

- 12 スライドテーブル
- 19 台座
- 25 回転機構
- 26 回転テーブル
- 3 1 支持台



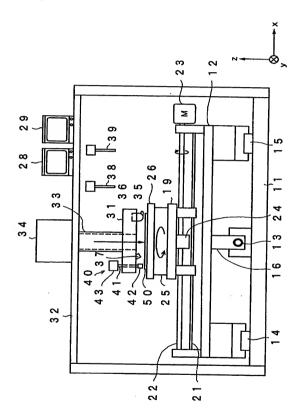
- 32 取付台
- 33 光学ホルダ
- 34 レーザ発振器
- 37 冷却ノズル
- 40 検出ユニット
- 41,71,74 光ファイバ
- 4 2 投受光部
- 43 判別部
- 50 ガラス基板
- 61 レーザダイオード
- 64 偏光ビームスプリッタ
- 67 フォトダイオード
- 6 9 判別部
- 100 ガラス基板自動分断ライン
- 101 カセットローダー
- 102, 104 コンベア
- 103 スクライブ装置
- 105 ブレイク装置
- LS レーザスポット BC ブラインドクラック
- CP 冷却ポイント
- DP 検出ポイント



【書類名】

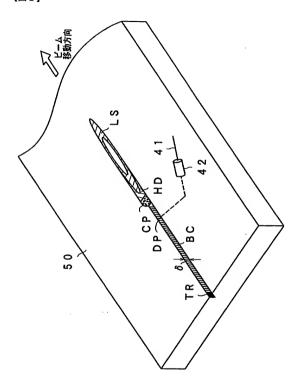
図面

【図1】





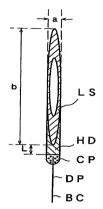
【図2】



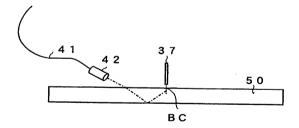




【図3】

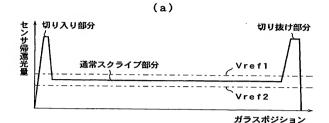


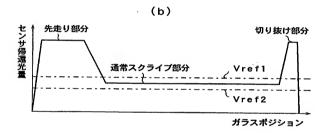
【図4】

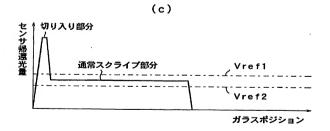




【図5】

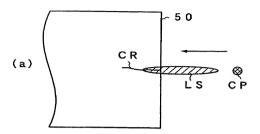


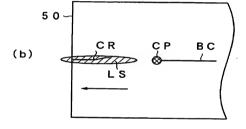






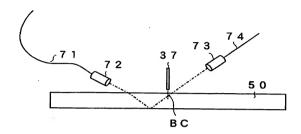
【図6】



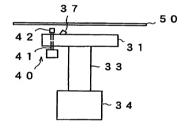




【図7】



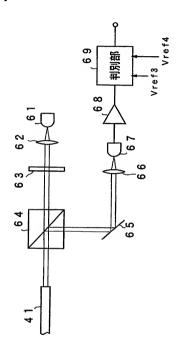
【図8】





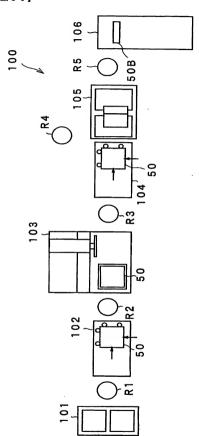


【図9】



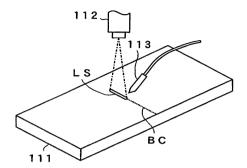


【図10】





【図11】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 脆性材料基板の表面に形成されるプラインドクラックの形成状況を確認できるようにすること。

【解決手段】 ガラス基板50の表面におけるスクライブラインが形成される領域に沿って、ガラス基板50の軟化点よりも低い温度でレーザスポットを連続して照射して加熱し、その近傍の領域を冷却する。これによりスクライブ予定ラインに沿ってブラインドクラックを形成する。検出ユニット40は光ファイバ41を介して光を冷却スポット近傍で形成された直後のブラインドクラックに向けて照射する。ブラインドクラックが形成されていれば、乱反射により一部の光が光ファイバ41に得られる。従ってこの反射光のレベルを検出することによってブラインドクラックが正常に検出されているかどうかを確認する。

【選択図】 図1

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2003-004282

受付番号

50300032721

書類名 担当官

特許願 第五担当上席

0094

作成日

平成15年 1月14日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成15年 1月10日

次頁無

出証特2004-3008920

## 特願2003-004282

# 出願人履歴情報

識別番号

[390006.08]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

氏 名

2002年 2月 5日 住所変更 大阪府吹田市南金田2丁目12番12号 三星ダイヤモンド工業株式会社